



中华人民共和国国家标准

GB/T 41064—2021/ISO 17109:2015

表面化学分析 深度剖析 用单层和 多层薄膜测定 X 射线光电子能谱、俄歇 电子能谱和二次离子质谱中深度剖析 溅射速率的方法

Surface chemical analysis—Depth profiling—Method for sputter rate
determination in X-ray photoelectron spectroscopy, Auger electron spectroscopy
and secondary-ion mass spectrometry sputter depth profiling using single and
multi-layer thin films

(ISO 17109:2015, IDT)

2021-12-31 发布

2022-07-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 单层和多层薄膜参考物质的要求	1
5 溅射速率的确定	2
附录 A (资料性) 国际比对实验报告	5
附录 B (资料性) 通过溅射产额列表值估算其他材料的溅射速率	11
参考文献	12